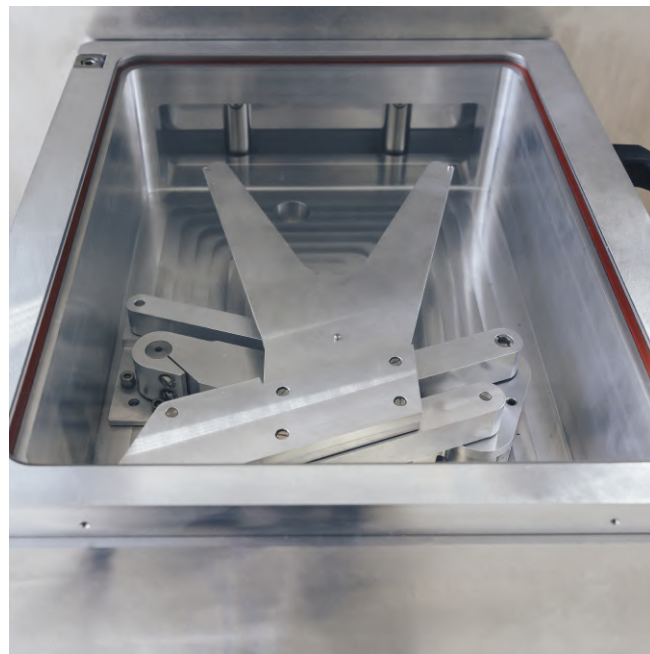


Изофаз ТМ 200-01

Установка плазмостимулированного атомно-слоевого осаждения
сверхтонких пленок



Технические характеристики:

Характеристика	Изофаз ТМ 200-01
Скорость осаждения, А/цикл	до 3
Количество одновременно обрабатываемых пластин, шт.	1
Температура подложкодержателя, °С	400
Диапазон ВЧ мощности ICP источника плазмы, Вт	3000
Осаждаемые слои	Al_2O_3 , HfO_2 , ZrO_2
Мощность потребления, кВт	14
Газовая система	В соответствии с требованиями заказчика

- Система загрузки: шлюзовая, шлюзовая из кассеты, SMIF-контейнер
- Обработка пластин \varnothing 76, 100, 150, 200, 300 мм
- Работа в автоматическом и ручном режимах
- Раздельная подача неоднородных прекурсоров/газов
- Встраивание в чистую комнату
- Габариты (ШхГхВ) не более 1000x2500x2100 мм

